

Busta 2

D1. Il candidato descriva le possibili tecniche litografiche per la realizzazione di dispositivi micro e nanostrutturati.

D2. Il candidato descriva un set-up di misura per la caratterizzazione ottica di dispositivi micro e nanostrutturati.

D3. Il candidato descriva una procedura di lavoro sicuro (accortezze nella manipolazione di sostanze chimiche, dispositivi di protezione individuale e collettiva) per l'utilizzo di sostanze chimiche (solventi organici, acidi, basi, resist) che vengono utilizzate durante un processo di fabbricazione di micro e nano dispositivi.